

第 63 回 応用物理学会春季学術講演会  
分科企画シンポジウム（中分類 6.5: 表面物理・真空）

## 真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析

*Gas Flow Analysis in Vacuum and Low-Pressure Processing*

プロセス装置等の真空容器やガス導入管内での気体の流れの解析・シミュレーションをテーマとするシンポジウム「真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析」を開催します。

半導体プロセス、FPD プロセスなどの開発に携わる応用物理学会会員の皆様方の多くは、真空や減圧環境下にあるプロセス装置を日頃から駆使して仕事を進めていらっしゃいますが、装置内での気体の流れは物質移動（輸送）の基本として重要であるものの、その挙動の詳細な把握は未だ難しいものがあります。特に、気体の分子間相互作用の大小によって粘性流・中間流・分子流に分類した際に、プロセス装置内の気体分子の流れは理論計算のみではすぐに答えの出ない中間流領域であることが多く、また、実プロセスにおいては中間流の多用に移行していることもあり、流れとその理解については理論・シミュレーション・計測・プロセス制御の何れからも多くの課題があります。

そこで本シンポジウムでは、分子流・中間流・粘性流に亘る理論及びシミュレーションを網羅する講演で構成し、実測およびシミュレータの開発と応用に関わった講演者の皆様にそれぞれの成果を解説いただき、真空・減圧プロセスにおける予測に基づく制御の可能性について考えてみたいと思います。

一般講演を募集します。奮っての投稿をお待ちいたします。

日時： 2016 年 3 月 20 日(日) 13:00～17:30（予定）

会場： 東工大 大岡山キャンパス

招待講演者（順不同・敬称略）：

- 松田七美男（東京電機大学）
- 谷本育律（高エネルギー加速器研究機構）
- 秋山泰伸（東海大学）
- 和田隆生（(株)ウェーブフロント）
- 松永史彦（ペガサスソフトウェア(株)）
- 田尻修一（(株)岡野製作所）

世話人：中村 健（産総研） 守山佳彦（東芝） 山田洋一（筑波大）